

RF 스퍼터링법에 의한 SBN 박막의 미세구조 특성

김진사, 송민종*, 최운식**, 박건호***, 조춘남****, 김충혁****

조선이공대학, *광주보건대학, **대불대학교, ***청강문화산업대학, ****광운대학교

Abstract : The $\text{Sr}_{0.7}\text{Bi}_{2.3}\text{Nb}_2\text{O}_9$ (SBN) thin films are deposited on Pt-coated electrode (Pt/Ti/SiO₂/Si) using RF sputtering method at various deposition temperature. The crystallinity of SBN thin films were increased with increase of deposition temperature in the temperature range of 100~400[°C]. The surface roughness of deposition temperature(300°C) showed about 4.33[nm]. The grain and crystallinity of SBN thin films were increased with the increase of annealing temperature.

Key Words : Deposition temperature, Crystallinity, Roughness, Annealing

1. 서 론

근래에 전원의 공급이 없어도 데이터가 손상되지 않는 비휘발성 메모리로서 FRAM (Ferroelectric Random Access Memory)에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.[1] FRAM은 비휘발성 특성과 더불어 저전압 동작 특성, 빠른 동작 속도, 10^{12} 이상의 기록가능 횟수 등의 많은 장점이 있다. 특히 강유전체 물질중 FRAM의 캐퍼시터로는 $\text{Pb}(\text{ZrTi})\text{O}_3$ (PZT), $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ (SBT) 및 $\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$ (SBN) 등의 물질이 주목을 받고 있다. 이전까지 강유전체로 가장 널리 연구되었던 PZT에 비해 잔류분극(remnant polarization: p_r)값은 작지만 비스무스 산화물 종이 완충층 역할을 하여 피로특성이 우수하다고 알려져 있으며, 동작전압이 작고 박막두께에 대한 Pr 값의 의존도가 거의 없어 고집적화에 유리한 특성을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 증착 및 조성제어가 용이하고 양질의 박막을 얻을 수 있는 RF Sputtering법을 이용하여 Pt/Ti/SiO₂/Si(100) 웨이퍼 위에 SBN 박막을 증착하여 미세구조 특성에 대하여 고찰하고자 한다.

2. 실 험

본 실험에서는 RF 스퍼터링법을 이용하여 증착온도에 따라 SBN 박막을 제조하였다. 제조된 박막은 전기로에서 600~800[°C]로 60분 동안 열처리하였다. 증착온도 및 열처리하여 얻은 SBN 박막에 대한 결정립의 크기 및 표면상태 등을 관찰하기 위하여 주사 전자 현미경(SEM)을 이용하여 관찰하였고, 시편 표면의 거칠기 분석은 AFM(Atomic Force Microscope)를 사용하였다. 또한 열처리온도에 따른 결정구조의 변화를 관찰하기 위하여 X-선 회절분석법(XRD)을 이용하였다.

3. 결과 및 검토

그림 1은 열처리온도가 증가함에 따라 입자의 크기가 점차 성장됨을 알 수 있었다. 특히 열처리온도 750[°C]에서는 입자가 크고 뚜렷하게 성장됨을 확인할 수 있었다.

그림 2는 SBN 박막을 열처리온도에 따라 관찰한 XRD 피크이다. 열처리온도가 증가할수록 박막의 결정성이 향상됨을 확인할 수 있었다. 특히 750[°C] 이상에서는 (115) 피크가 아주 크게 성장되었다.

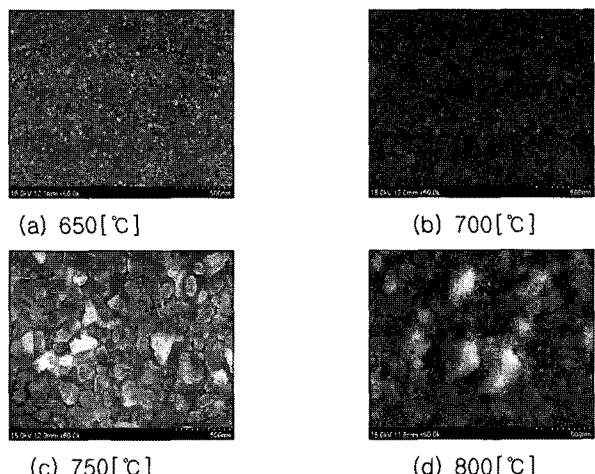


그림 1. 열처리온도에 따른 SBN 박막의 전자 현미경 사진

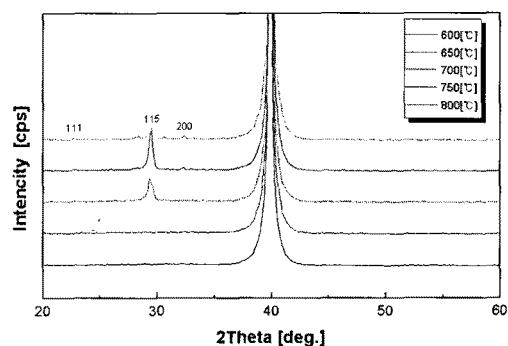


그림 2. 열처리온도에 따른 SBN 박막의 XRD

4. 결 론

열처리온도가 증가함에 따라 SBN 박막의 입자성장은 뚜렷하게 증가하였으며, 특히 열처리온도 750[°C]에서는 입자가 크고 뚜렷하게 성장됨을 확인할 수 있었다. XRD 분석으로부터 열처리온도 750[°C]에서 가장 안정한 구조로 성장됨을 알 수 있었다.

참고 문헌

- [1] Dinghua Bao, Naoki Wakiya, Kazuo Shinozaki and Nobuyasu Mizutani, J. Phys. Appl. Phys. 35 No.3, L1-L5, 2002.